PULSE STRUCTURE OF THE PXR INTENSITY AT LEBRA, NIHON UNIVERSITY^{*}

Kyoko Nogami^{1,A)}, Manabu Inagaki^{B)}, Yasushi Hayakawa^{A)}, Ken Hayakawa^{A)}, Toshinari Tanaka^{A)}, Takeshi Sakai^{B)}, Keisuke Nakao^{A)}, Tatsuya Takikawa^{C)}, Isamu Sato^{B)},

^{A)} Institute of Quantum Science Nihon University, 7-24-1 Narashinodai, Funabashi, Chiba, 274-8501

^{B)} Advanced Research Institute for the Science and Humanities Nihon University,

12-5 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8251

^{C)} College of Science and Technology Nihon University, 1-8-14 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8308

Abstract

Since the LEBRA-PXR system is driven with the long pulse duration of 10 μ s, the transition of PXR state in the pulse is one of the most significant problems to understand its behavior. Thus, the pulse structure of the PXR intensity is measured with a scintillation detector. As the results, the correlation between the electron beam spot size on the target crystal and the pulse structure of PXR intensity is observed. Typically, the PXR intensity rapidly changes in the case of the small electron beam spot. Additionally, the pulse structure strongly depends on the angle of the second crystal. Therefore, these results suggest that the state of the target crystal such as distortion and thermal strain changes associated with the electron beam bombing.

日大LEBRA-PXR強度の時間構造

1. はじめに

日本大学電子線利用研究施設(LEBRA)では、 125MeV電子線加速器を基盤としたパラメトリック X線放射(PXR)によるX線源の開発を行い、2004年から利用実験を開始している。現在までに、LEBRA では5.0-20keVまでの連続エネルギー可変単色X線の 発生に成功しており、X線吸収微細構造(XAFS)や イメージング等に応用されている^[1]。

PXRの従来の研究では、光子数計測による測定が 主体であったため、電子ビーム照射に伴う時間的に 速い変動についての研究が不十分であった。 LEBRA-PXRの場合、比較的マクロパルス幅の長い リニアックを用いているので、マクロパルス内での PXR強度の時間変動が重要になる。そこで、シンチ レーション検出器を導入しPXR強度の時間構造の基 礎的な実験が行われ、実際のマクロパルス幅10µsで の時間構造を測定できることが確認された^[2]。さら に、PXR強度の時間構造について詳細に調べるため、 シンチレーション検出器を用いて電子ビーム形状と 時間構造の関係について検証を行った。

2. 電子ビーム形状とPXR強度の時間構造

電子ビームの集束条件を変え、電子ビーム形状と そのとき得られるPXR強度の時間構造の関係につい て調べる。図1に実験のセットアップを示した。 PXR発生装置直前に設置された金属薄板、または、 PXR発生装置の第1結晶(PXR発生用ターゲット結晶)



図1:本実験セットアップ

^{*}本研究は文部科学省学術フロンティア推進事業(継続)(平成17~19年度)

¹ E-mail: nogami@lebra.nihon-u.ac.jp

に電子ビームが照射した際に発せられる遷移放射光 (optical transition radiation: OTR)を利用して電子ビー ムの形状を確認した。このとき、9.661 keV、16 keV、 18.98 keVのPXR強度の時間構造をシンチレーション 検出器で測定した。それぞれの電子ビーム形状で得 られた時間構造を16パルス分平均した結果、電子 ビームサイズが数mm以上の場合には、マクロパル ス内でほぼ一様なPXR強度が得られたが、電子ビー ムを1mm以下に集束した場合は1-2µs程度のパルス 幅でしかPXR強度が得られなくなるという傾向が確 認された(図2)。PXRエネルギーを変えても同様な結 果が得られることから、電子ビーム形状と得られる PXR強度の時間構造に相関があると考えられる。こ れは、水平方向(PXRエネルギー分散方向)に集束し た場合、特に顕著に現れた。



図2:電子ビーム形状とPXR強度の時間構造 電子ビーム形状(縦x横)が、約(a)3x3 mm、(b)3x1 mm、 (c)1x3 mmの場合についてPXRエネルギー18 keV(青)、 16 keV(ピンク)、9.661 keV(黄緑)それぞれ16パルス平均 した時間構造を示す。図中のOTR画像は、PXRエネル ギー16keVのとき第1結晶で発生したものであり、ス ケールバーは3 mmを表す。

2.1 回折曲線と時間構造

次に、第2結晶(反射板)の角度0,を変化させたとき に得られるPXR強度の時間構造の変化の測定を行っ た。今回はPXRエネルギー9.661 keVおよび16 keVの とき、各電子ビーム形状について回折曲線を測定し た。そこで得られた時間構造を16パルス分平均し、 さらにそれをマクロパルス内で3分割して各時間で の出力電圧の積分値(絶対値)を求め、出力窓サイズ (\$100 mm)のイオンチェンバで得られたPXR強度と 比較した。その結果、電子ビームサイズが数mm以 上の場合、PXR強度は回転角θっに対してマクロパル ス内のどの時間でもほぼ同じ回折曲線を描くことが わかった。一方、電子ビームサイズを1 mm以下に 集束した場合は、マクロパルスの前半と後半では回 折曲線に顕著な違いが見られ、各時間での積分強度 が強くなる角度が異なり、さらにマクロパルスの後 半で強度が強くなるような角度があることがわかっ た(図3)。

2.2 空間分布

PXRは、ホロービーム状のビームプロファイルを 示すという特徴がある^[3]。そこで、PXRビームプロ ファイル各部でのPXR強度の時間構造の変化を調べ



図3:マクロパルス内の各時間における回折曲線 得られたPXR強度の時間構造を16パルス分平均し、さら にマクロパルスを3分割(青、赤、緑の順)して各時間での 回折曲線を示した。各図の電子ビーム形状(縦x横)とPXR エネルギーは、(a)約3x3mm/16keV、(b)約3x1mm/16keV、 (c)約3x3mm/9.661keV、(d)約3x1mm/9.661 keVである。ま た、X線出力窓サイズのイオンチェンバの出力信号を規 格化したもの(ピンク)も示した。

るために、X線出力窓に対してシンチレーション検 出器の位置を移動させ計13箇所の時間構造を測定し た(図1正面拡大図)。このときのPXRエネルギーは、 9.661 keVで、第2結晶の角度62はシンチレーション 検出器をX線出力窓の中心(図1正面拡大図中の1)に 設置したとき、PXR強度が最大となる角度に固定し た。電子ビームサイズが数mm以上の場合、PXR強 度の時間構造はPXRビームプロファイル各部で変化 していることがわかる。これに対して、電子ビーム サイズを1 mm以下に集束させた場合は、PXRビー ムプロファイル各部の強度分布を反映しているだけ で、時間構造に変化はみられなかった(図4)。



図4:PXRビームプロファイルに対する時間構造 (a)電子ビーム形状が径3mmのとき、PXRビームプロファ イルの中心に対して時間構造の変化が顕著だった部分を 示した(図1における1、4、5、9の位置)。(b)電子ビーム 形状が3x1 mm(縦x横)のとき(a)と同じ位置での比較。得 られた時間構造は、16パルス分平均したものである。

3. 考察とまとめ

今回、シンチレーション検出器を用いてPXR強度 の時間構造を測定した。その結果、電子ビーム形状 とPXR強度の時間構造に相関があった。電子ビーム サイズが数mm以上の場合、マクロパルス内でほぼ 一様なPXR強度が得られるのに対して、電子ビーム サイズを1 mm以下に集束すると1-2 µs程度のパルス 幅でしかPXR強度が得られないことがわかった。ま た電子ビームサイズを小さくした場合において、 PXR強度の前半と後半では発生装置の第2結晶の角 度02による回折曲線に顕著な違いがあり、電子ビー マクロパルスの前半より後半でPXR強度が強くなる 角度があることが認められた。これは、第1結晶の

ある状態で発生したPXRを優位に反射する第2結晶 の角度θ2が異なることを意味していると思われる。 これらのことから、電子ビーム照射自体による第1 結晶の状態変化(ゆがみ、熱ひずみ)がマクロパルス 内で起こっていることが示唆され、電子ビーム形状 によってもその変化の仕方に違いがあると考えられ る。電子ビームサイズが数mm以上と大きい場合に 比べて、1 mm以下に集束した場合の回折曲線はマ クロパルス内の各時間で差が大きいことから、第1 結晶の状態変化がより大きいと考えられる。さらに、 X線ビームに対する空間分布の測定から、電子ビー ムサイズを小さくし1-2 µs程度でPXR強度を得る場 合のほうが、空間的にほぼ同じ時間構造となった。 したがって、電子ビームサイズを特に水平方向に小 さくし、電子ビームのマクロパルス幅を短くするこ とによって、第1結晶のある特定の状態で発生する PXR成分だけを得ることができ、精度の高い実験を 行うことができると考えられる。

本研究は、文部科学省学術フロンティア推進事業(継続)(平成17~19年度)「可変波長高輝度単色光源の高度利用 に関する研究」の支援を受けて行った。

参考文献

- Y.Hayakawa et al., "Advanced Applications of PXR at LEBRA, Nihon University", International Conference on Charged and Neutral Particles Channelling Phenomena, Frascati (Rome), July, 2006
- [2] 滝川達也 et al., "NaI(Tl)シンチレーション検出器によるパラメトリックX線放射の時間構造測定", 文部科学 省学術フロンティア推進事業(継続)「可変波長高輝度 単色光源の高度利用に関する研究」シンポジウム 赤 外自由電子レーザとパラメトリックX線 利用研究の 進展, Funabashi, Feb., pp141-143, 2007
- [3] M.Inagaki et al., "Performance Evaluation of DXAFS Measurement Using Parametric X-ray Radiation", Proceedings of the 3rd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 31st Linear Accelerator Meeting in Japan, Sendai, Aug., pp526-528, 2006.